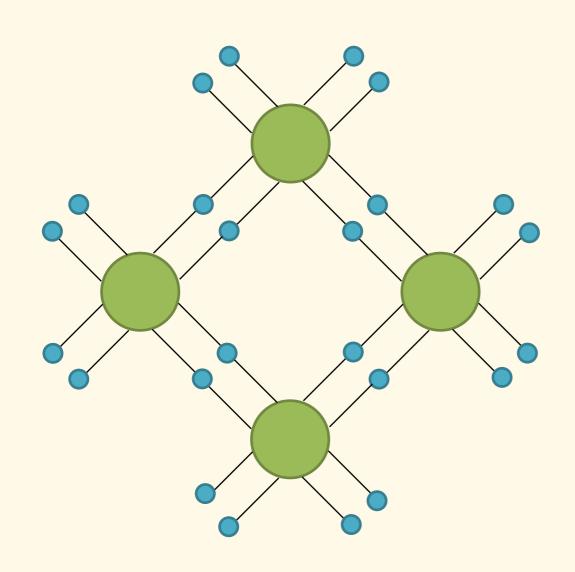
電子工学08

津山工業高等専門学校 情報工学科 講師電気通信大学 先進理工学科 協力研究員藤田一寿

真性半導体

- 不純物や結晶格子の欠陥が全くない単結晶半導体
 - Siの場合半導体用途で11N(純度 99.9999999999%イレブンナイン)で製造される。

絶対零度のとき



電子はすべて結合に寄与する

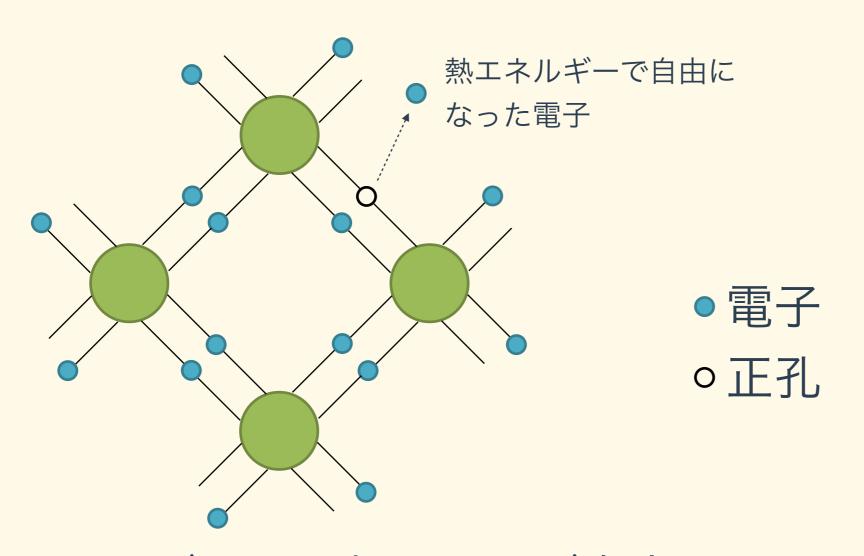
伝導帯

禁制帯 (バンドギャップ)

価電子帯

伝導帯に電子はなく 電気は流れにくい

T>0の場合



熱エネルギーで一部の電子が自由になる。 電子がもともと板場所には+の電気的性質 を持ったあな(孔)があく。これを正孔と 呼ぶ。

伝導帯 熱エネルギーで励起 される。

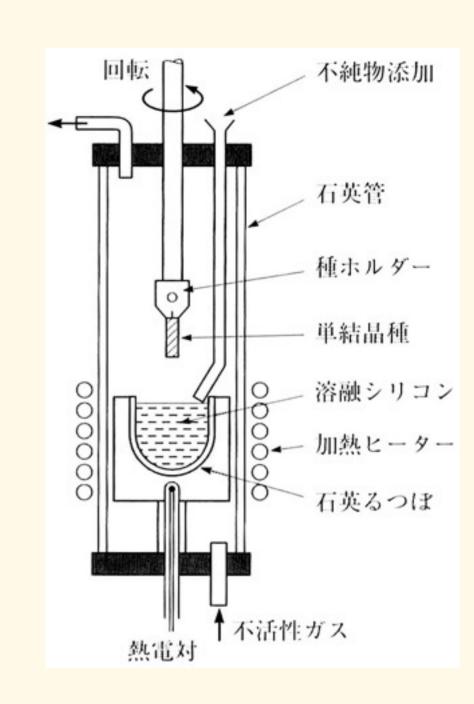
価電子帯

真性半導体

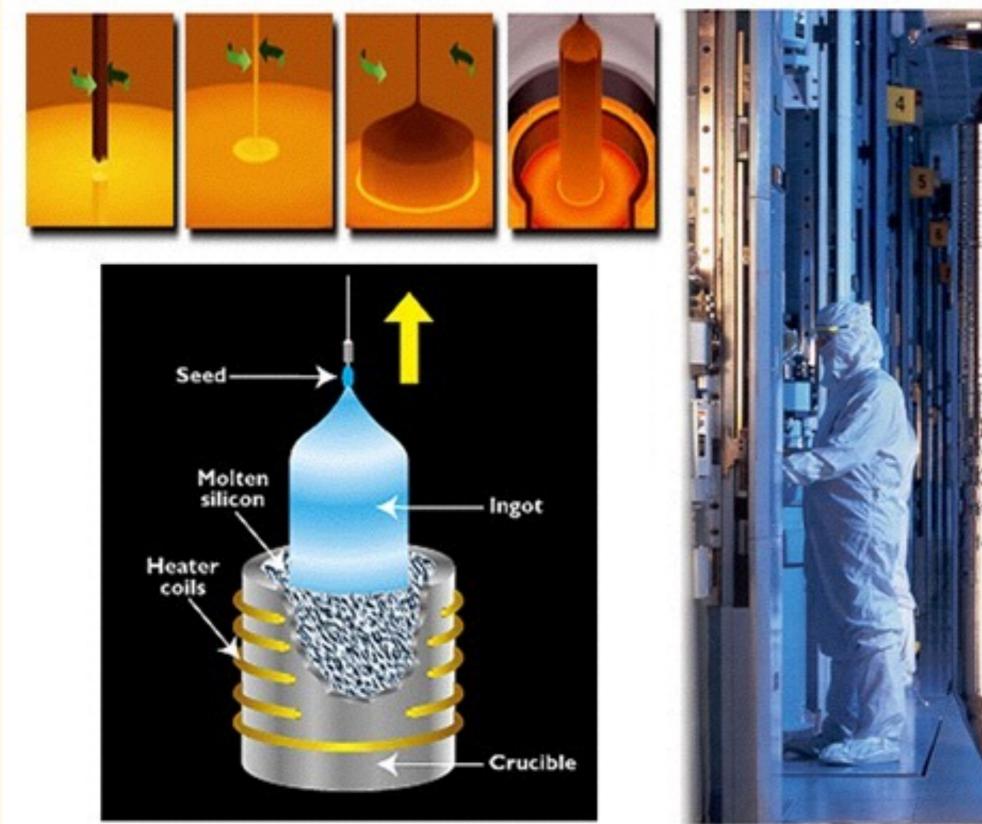
- 熱エネルギーにより自由になった電子は、価電子帯から伝導帯に励起されている。
- 電子が抜けた場所は、+の電気的性質を持つ 正孔(ホール)ができる。
- 伝導帯にいる電子は電気を流す役割をする。
 - ・電気を流す役割をするものをキャリアと呼ぶ
- ・ 真性半導体の場合、電子と対となり正孔が電気を流す役割をするので、電子と正孔がキャリアとなる。

製造方法

- チョクラルスキー法(引き上げ法)
 - るつぼの中にシリコン原材料を入れ加熱溶融する。
 - 上から種結晶を下ろし、その 先端を液状態のシリコンにつ ける。
 - 種結晶を回転させ引き上げる。(毎分1mm、10回転)



(豊田、半導体の科学とその応用)





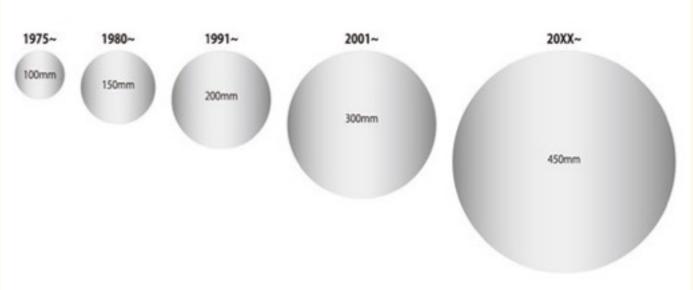
(http://cnfolio.com/)



東京大学総合研究博物館

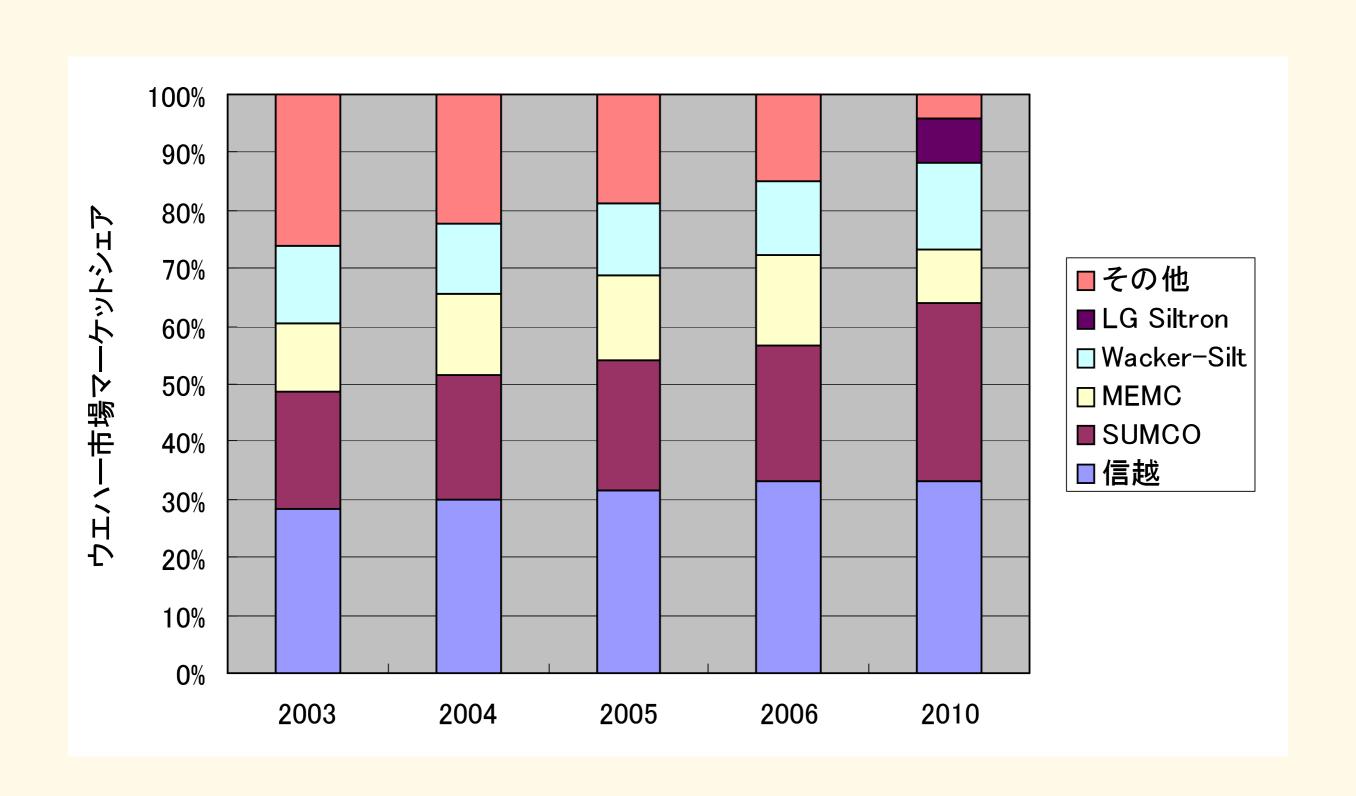
シリコンウェハのサイズ





(SUMCO)

シリコンウェーハのシェア

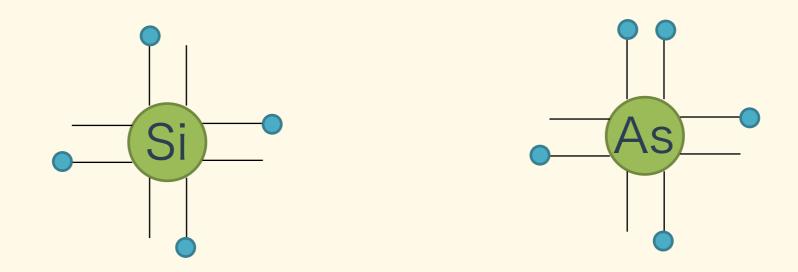


不純物半導体

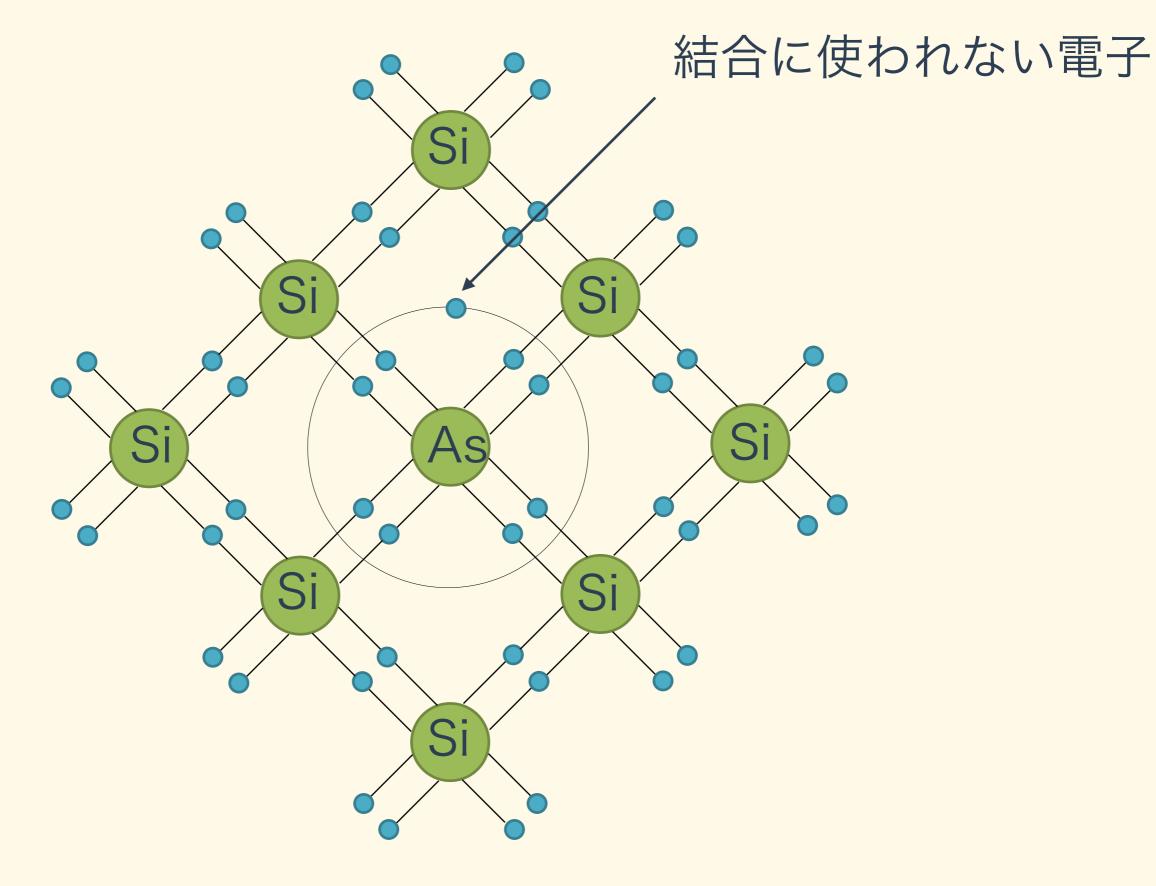
・ 真性半導体に微量の不純物を入れ(ドープ)キャリアを作ることができる(ドーピング)。このようにして作った半導体を不純物半導体(外因性半導体)という。

n型半導体

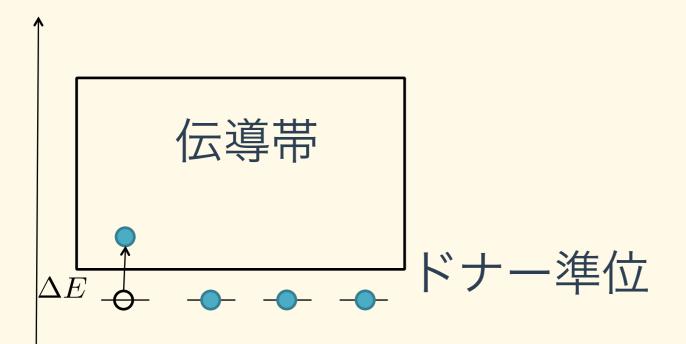
- ▶ 真性半導体に5価の不純物(最外殻電子が5個)を ドープする。
 - ・不純物をドナー不純物という。



シリコンは最外殻電子が4つ ヒ素は最外殻電子が5つ



結合には4つの電子があれば良いので、電子はひとつ 余る。結合に使われない余った電子がキャリアとなる。



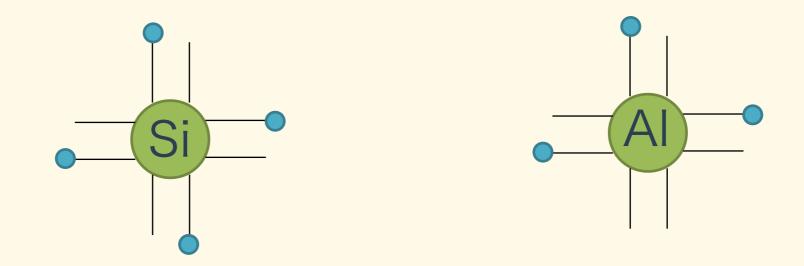
結合に使われない余った電子は、ドナー準位とよばれるエネルギー 準位を形成する。

価電子帯

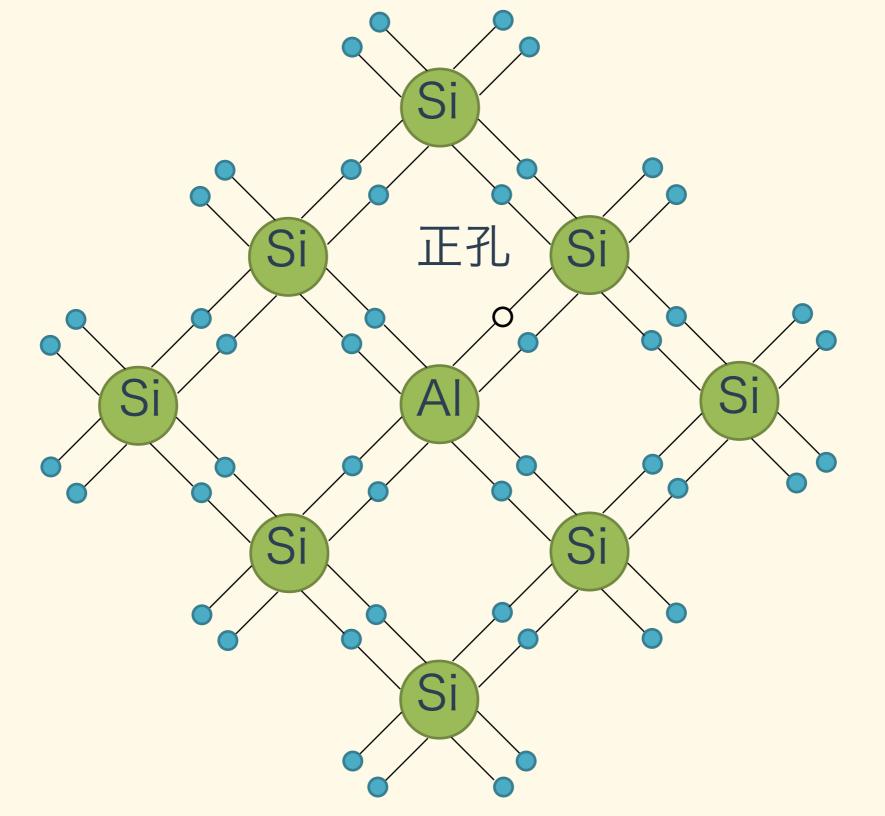
ドナー準位にある電子は僅かな熱エネルギーで 動起され、伝導電子になる。

p型半導体

- ・ 真性半導体に3価の不純物(最外殻電子が3個)を ドープする。
 - 不純物をアクセプタ不純物という。



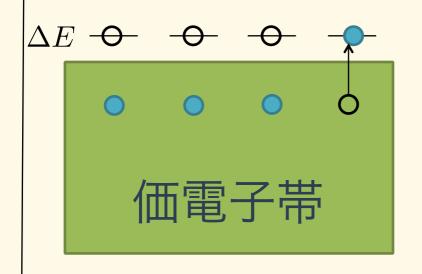
シリコンは最外殻電子が4つ アルミニウムは最外殻電子が3つ



3価の原子を使ったため、電子が足りない状況になる。足りない場所は+の電気的性質を持ったあな(正孔、ホール)となる。この正孔が電気を流すキャリアとなる。

伝導帯

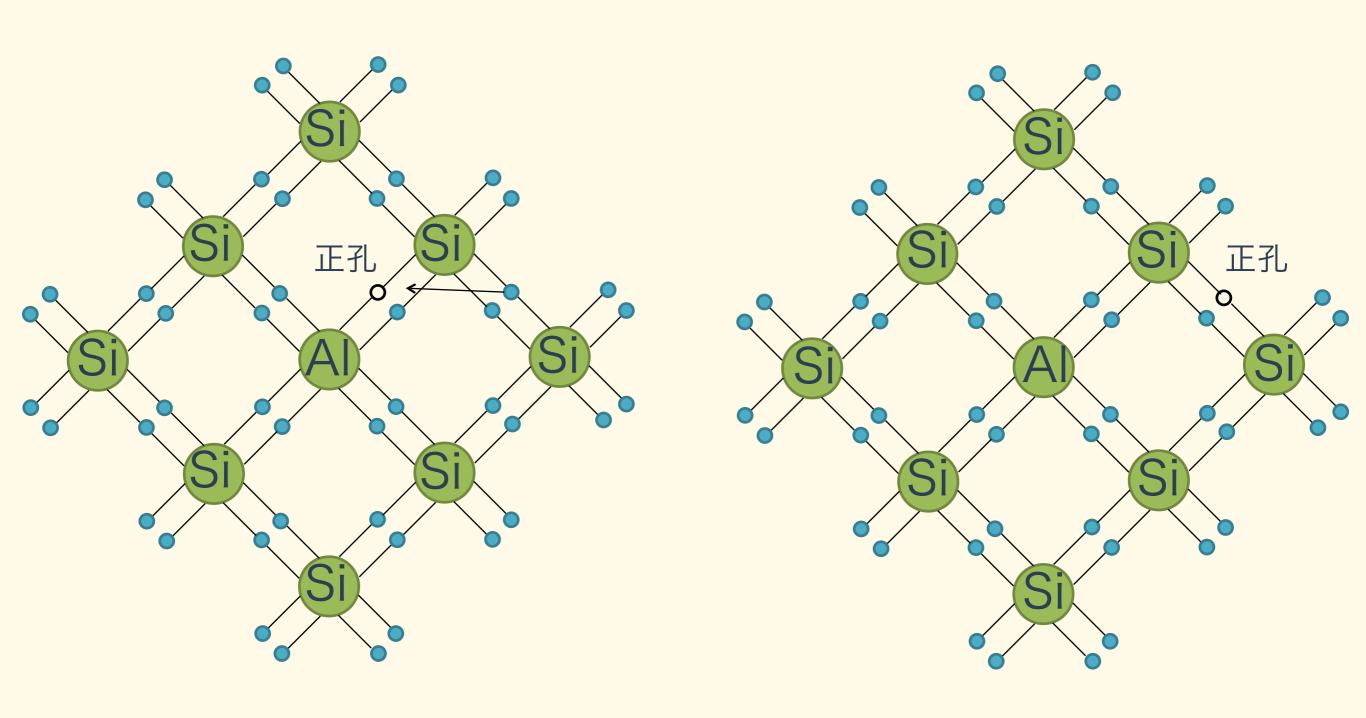
アクセプタ準位



アクセプタ不純物が作る エネルギー準位をアクセ プタ準位という。

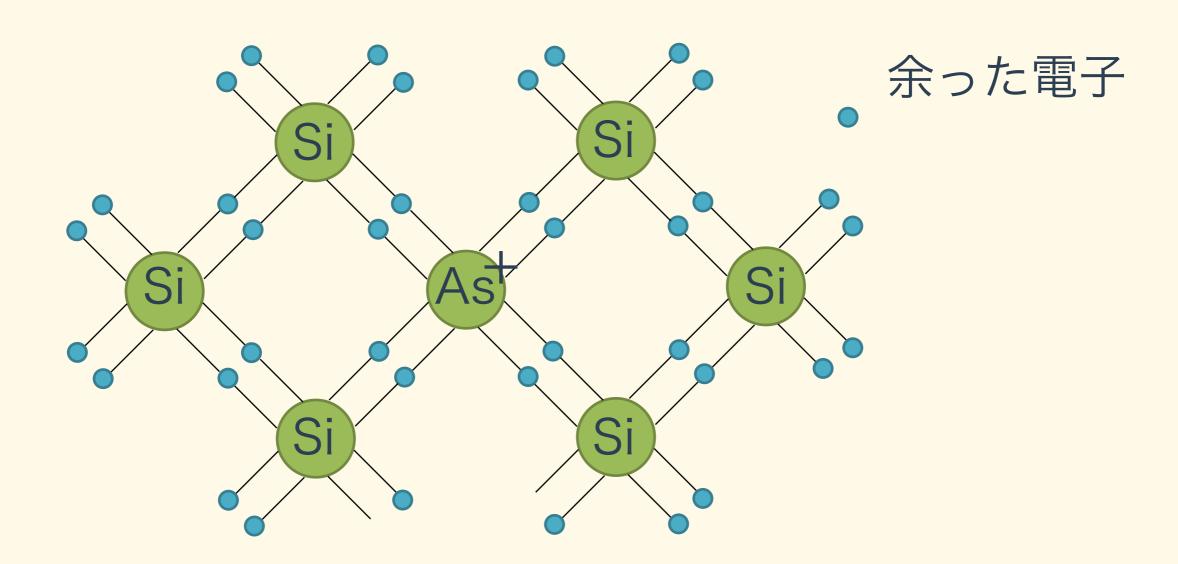
電子は熱によりアクセプタ準位励起される。その結果価電子帯に正孔が形成される。

これは、結晶の結合手から電子が次々と正孔を埋めていくことに対応する。



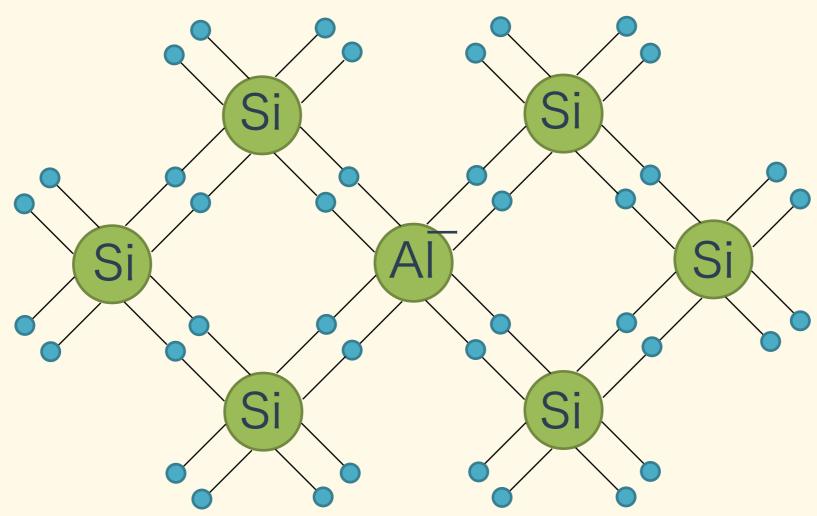
椅子取りゲームのように正孔に電子が移動する。結果 として正孔は結晶内を移動することになる。

ドナーイオン



ドナーから余った電子が遠くへ行ってしまうと、ドナーは電気的には+となる(イオン化される)。イオン化されたドナーをドナーイオンと呼ぶ。

アクセプタイオン



正孔に電子が入ってしまうと、アクセプタ不純物は電気的に一になる。イオン化されたアクセプタ不純物をアクセプタイオンと呼ぶ。

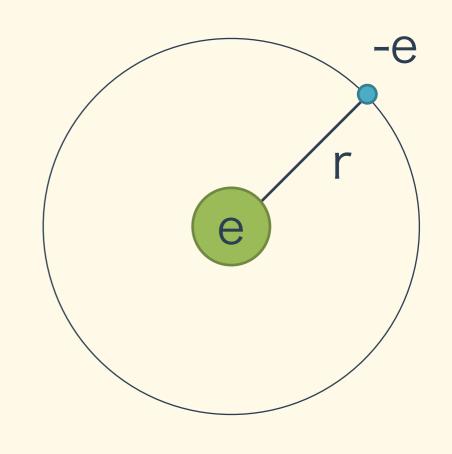
多数キャリア

- ・ 実際には、n型半導体、p型半導体にも電子とホールの両方のキャリアが存在している。
- 半導体の中のキャリアとして、圧倒的に多い方を多数キャリア、少ない方を少数キャリアと言う。
- ▶ n型半導体の場合,電子が多数キャリア
- ▶ p型半導体の場合,ホールが多数キャリア

ドナーのイオン化エネルギー

ドナーイオンがイオン化するためのエネルギーを求めてみる. ドナーの周りに電子が回っていると考える. その電子が, ドナーから離れることで, ドナーはイオン化する. よって, イオン化エネルギーはボーアの水素モデルから

$$E_n = -\frac{1}{2} \left(\frac{1}{4\pi\varepsilon_0 \varepsilon_r} \right)^2 \frac{e^4 m^*}{\hbar^2}$$



と求められる。しかし、電子は結晶内にあるため、誘電率や質量を水素と同じものが使えない。誘電率は比誘電率 ε_r を掛ける必要があり、質量は有効質量 m^* を使う必要がある。

フェルミーディラック統計

- 固体中の電子は莫大に存在する
- ▶ 統計と使って電子の状態を考える
- ▶ 固体中の電子の状態は、フェルミーディラック統計に 従う
 - エネルギー準位は量子化されている。
 - あるエネルギーの範囲にある電子の数は制限される
 - ・電子がエネルギーEの状態を占有する個数(割合)を決められる.

フェルミーディラック分布

電子があるエネルギー準位を占める割合

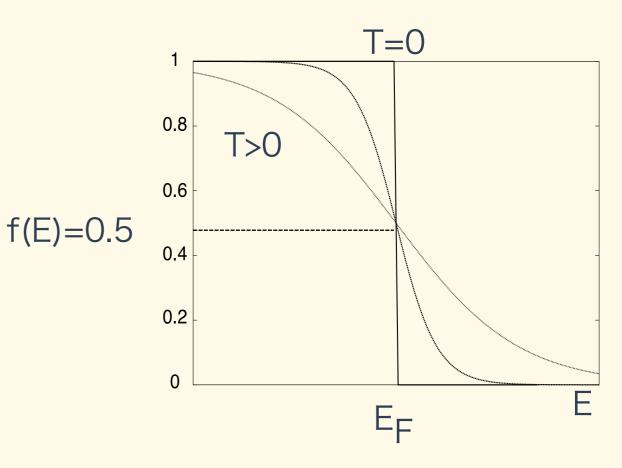
$$f(E) = \frac{1}{\exp(\frac{E - E_F}{k_B T}) + 1}$$

E:エネルギー

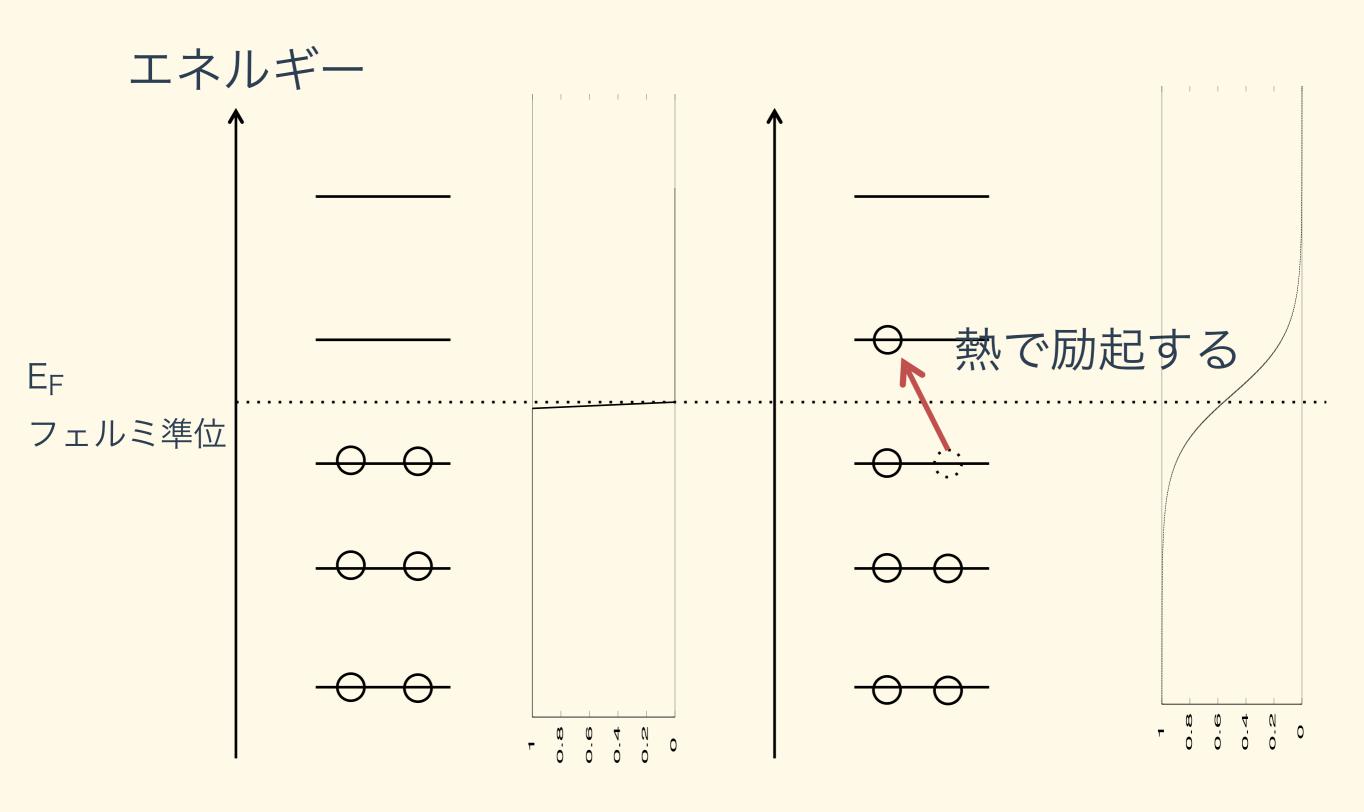
E_F:フェルミ準位

k_B:ボルツマン定数

T:絶対温度



フェルミ分布



T=0 (絶対零度)

T>0

問題

フェルミ-ディラック分布関数において $E=E_F+\delta$ とすれば $f(E)=f(E_F+\delta)$ と表される. このとき,

$$f(E_F + \delta) = 1 - f(E_F - \delta)$$

となることを示せ、そして、その意味を考えよ、

ホール効果

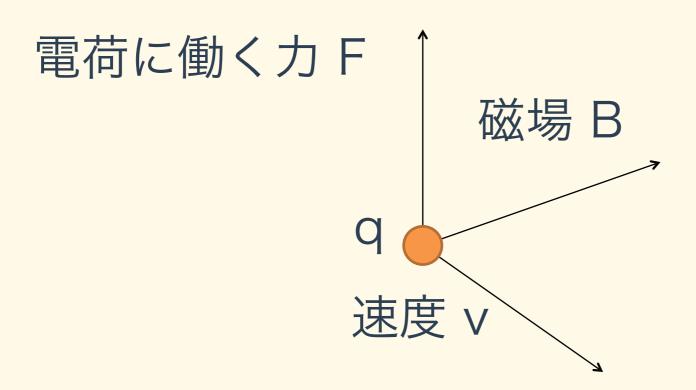
- キャリアの密度を測るために用いられる物理現象
- まずはホール効果を理解するために電子が磁場から 受ける影響について学ぶ。

磁場

- 電場が電子の周りにできたのに対し、磁場は磁石の 周りにできる。
 - ▶ 磁場は電流により発生する.
 - ▶ 電荷に対応した磁荷は存在しない。
 - ▶ 磁場の強さを表す物理量の一つが磁束密度B

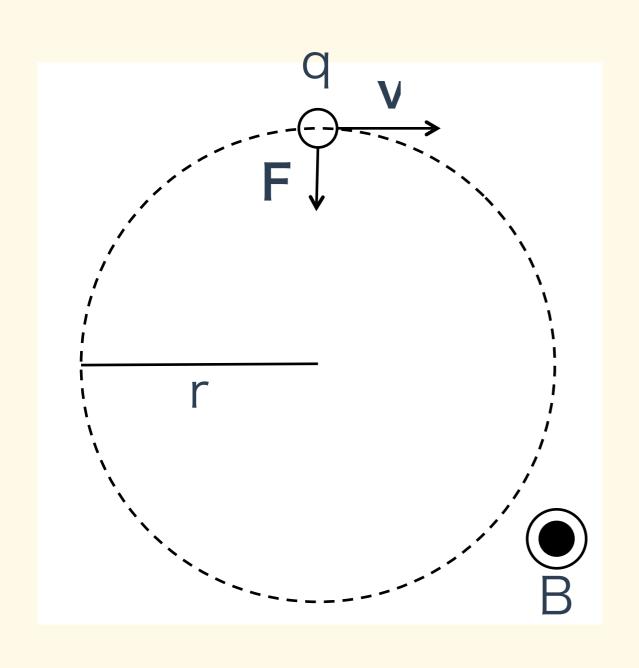
磁場の影響を受ける電荷

運動する電荷は磁場の影響を受ける。



$$F = qv \times B$$

磁場中の電荷の動き



- 磁場中を移動する電荷は進行方向に対し垂直な力を受ける
- 進行方向に対し垂直 な力は向心力となり 円運動をする



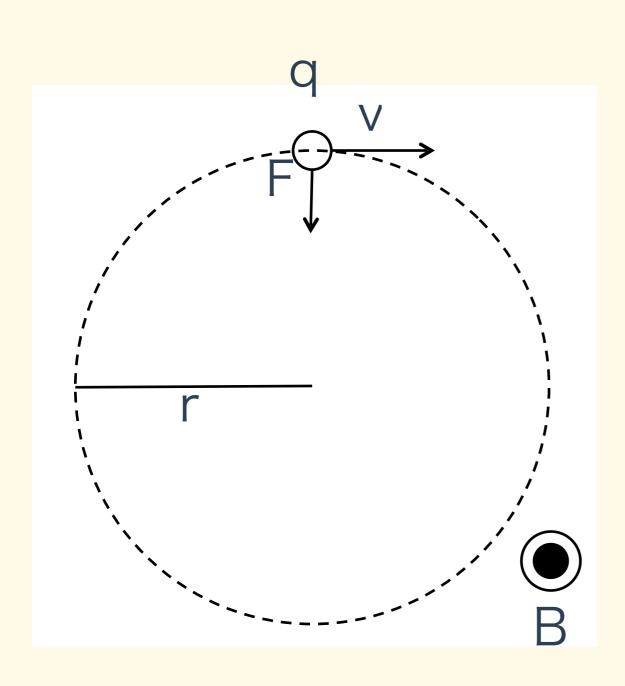


画面から垂直に出ている



画面に向かって垂直に 入っている

磁場中の電荷の動き



磁場から受ける力が向心力と なるので

磁場による力
$$r = qvB$$
 mv $r = mv$ qB

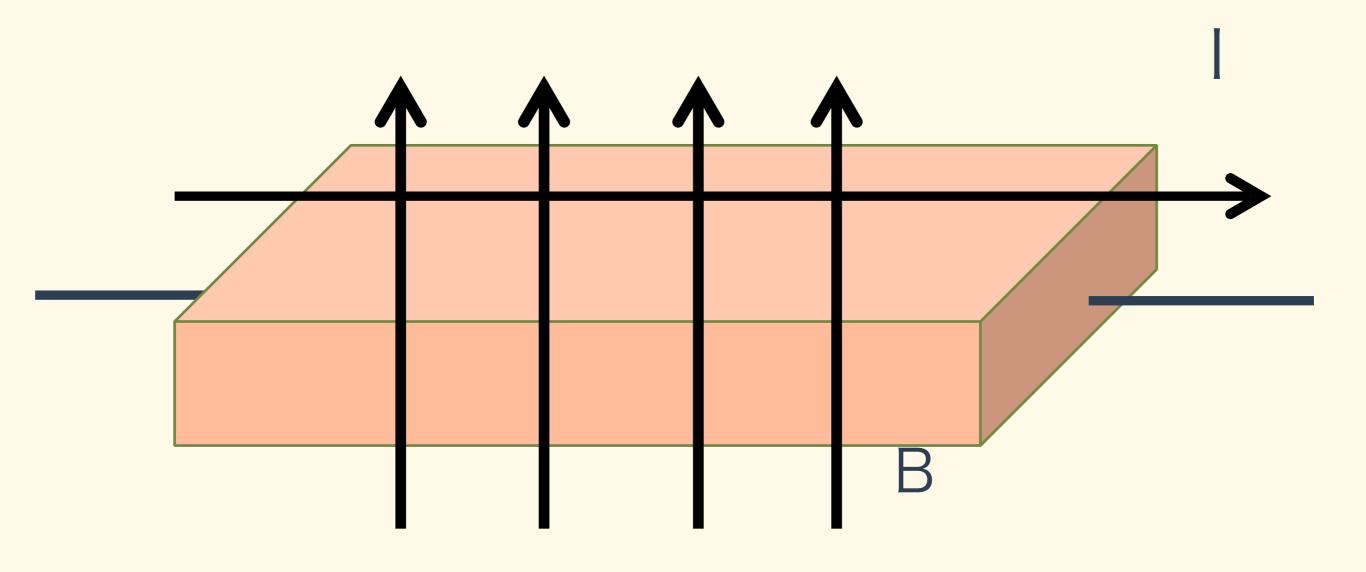
ローレンツカ

- 電荷が受ける力は電場からのものと、磁場からのものがある。
- それをローレンツ力という。

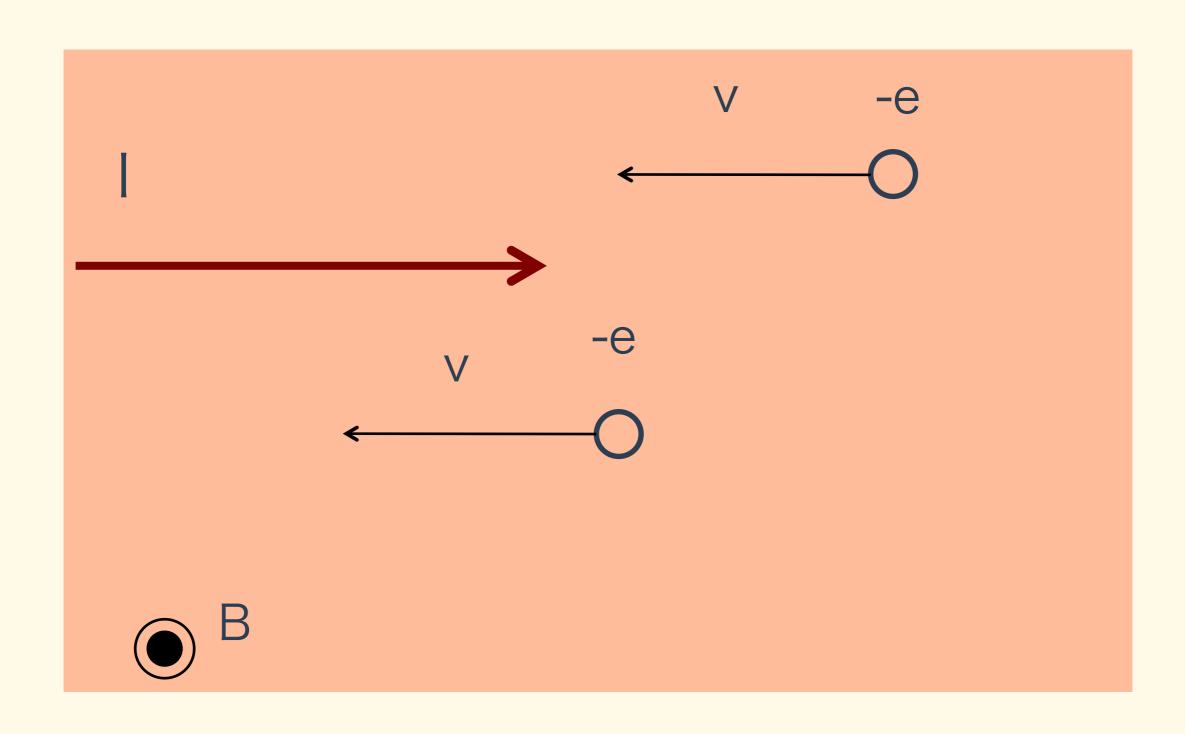
磁場から受ける力 $oldsymbol{F}=oldsymbol{qE}+oldsymbol{qv} imes oldsymbol{B}$ 電場から受ける力

ホール効果

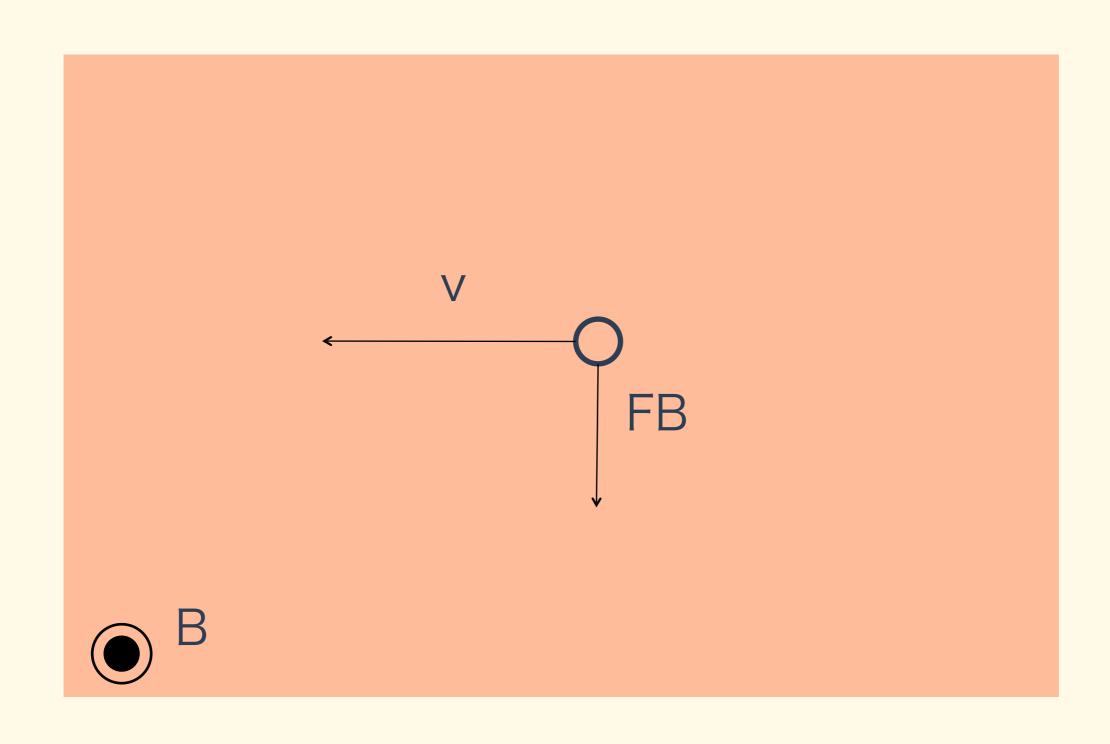
電流に対し垂直に磁場をかけると、電流が曲がる。曲がることで、電荷の偏りが生じ起電力が発生する。



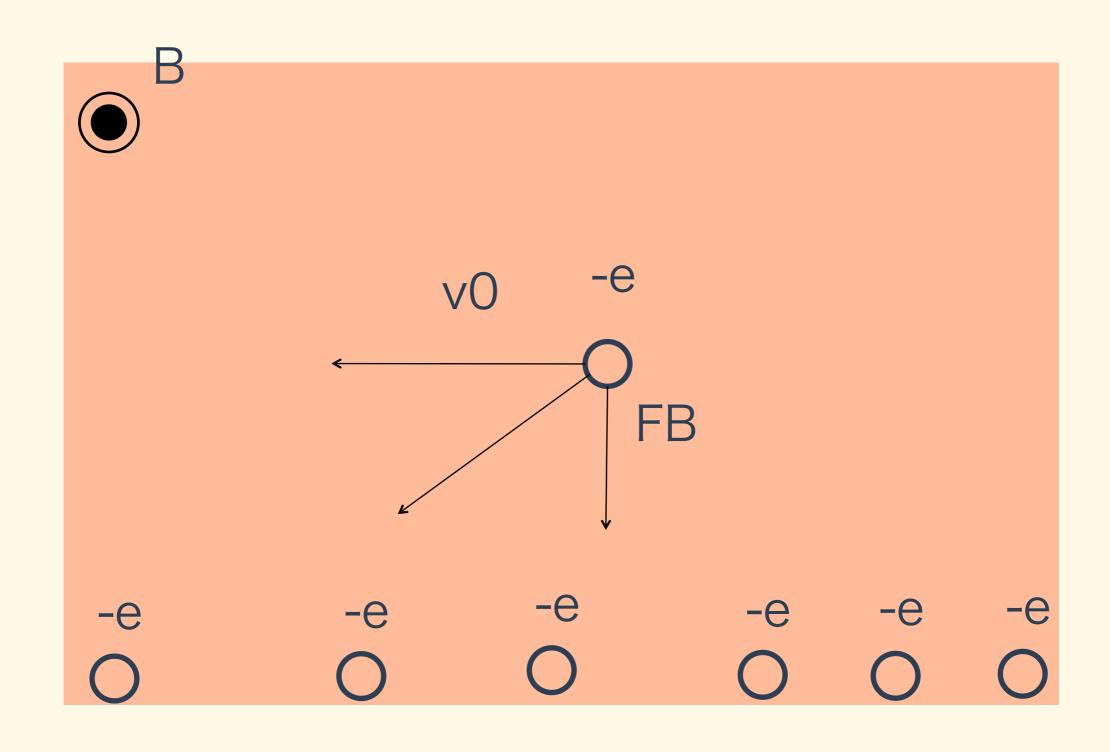
原理



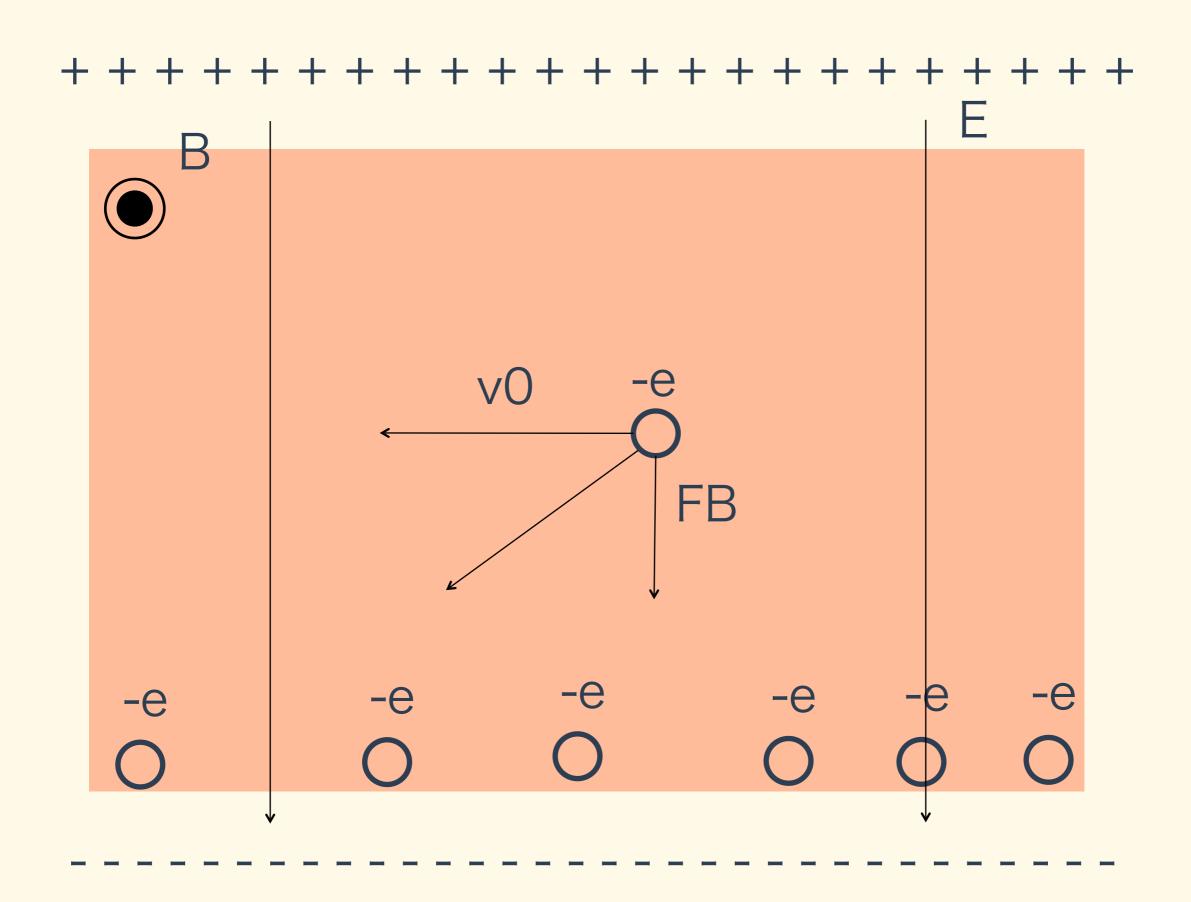
動いている電子は磁場から力を受ける



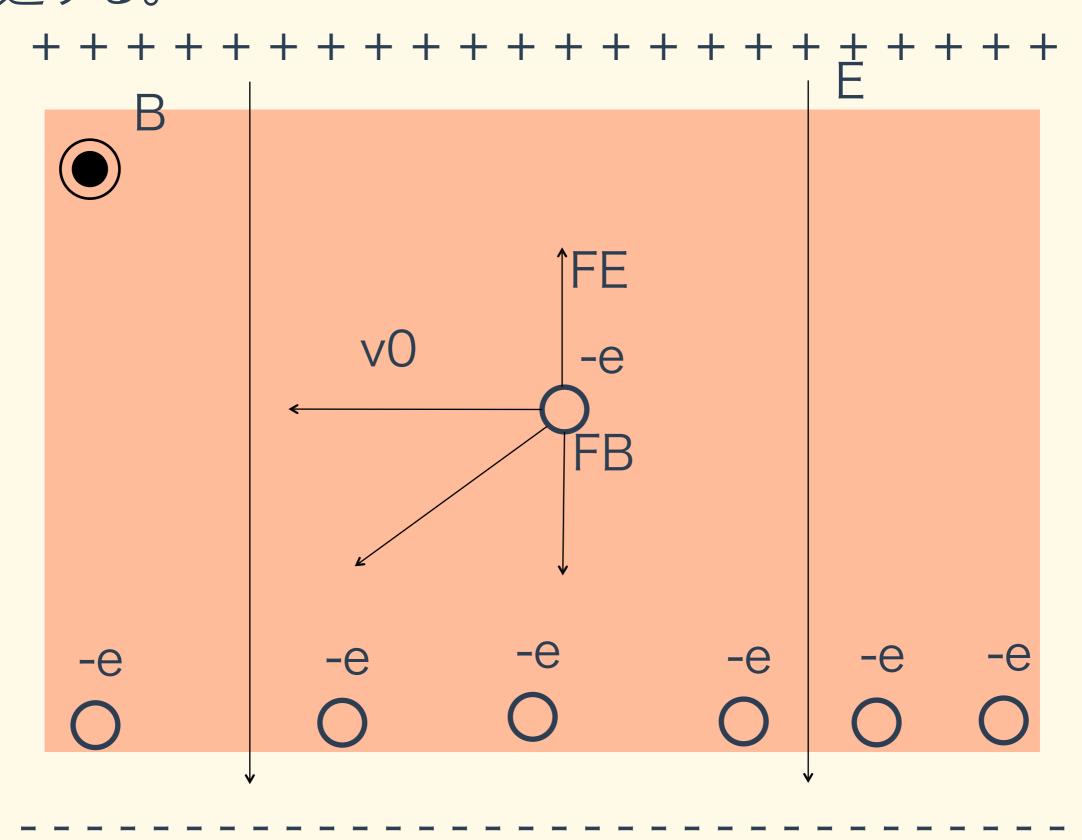
電子は曲がり、端に溜まってくる



端に溜まった電子により電場Eが生じる



磁場から受ける力と電場から受ける力が釣り合い電子は 直進する。



数式で表すと

・電流密度は

$$i = qnv$$

▶ 電場と磁場による力は釣り合うので

$$F_B = F_E$$

$$qvB = qE$$

$$v = \frac{E}{B}$$

i: 電流密度

q: 電荷

n: 電荷(キャリア)密度

v: 速度

$$i = qn\frac{E}{B}$$

$$E = R_H i B$$

$$R_H = \frac{1}{nq} \quad \pi - \mu$$
 本

ホール効果を用いることで、電流に寄与する電荷(キャリア)の密度を知ることができる。